

知的財産

基盤技術別の知的財産活動概略

1. 基盤技術の国内、国外における公開特許件数の推移

(1) 国内

国内における公開特許件数は「光学技術」「電子映像技術」「精密技術」「生体基盤技術」ともに、前期比増加となりました。出願を厳選しつつも、有用な発明に関しては積極的に出願しています。

(2) 国外

国外における公開特許件数は、「光学技術」「電子映像技術」において増加、「生体基盤技術」は概ね例年並み、「精密技術」は減少となり、全体として前期比増加となりました。これは、新興国市場への事業展開の強化をはじめとするグローバル化に向け、国外出願を増強する施策を継続展開していることによります。特に中国において「光学技術」「電子映像技術」に関する公開特許件数が増加しました。

2. 保有特許全体に占める基盤技術の割合

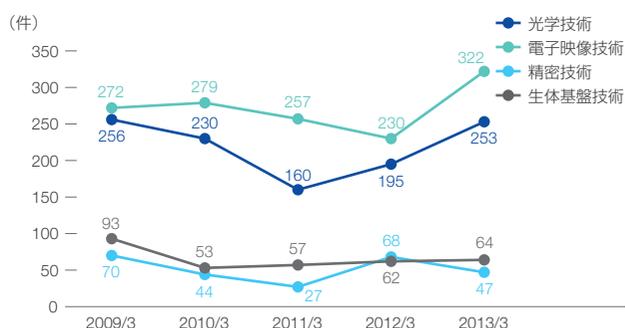
基盤技術が国内外保有特許全体に占める割合は59%で前期と同様です。

各基盤技術が全体に占める割合も大きな変化はなく、光学技術と電子映像技術で全体の46%を占めています。

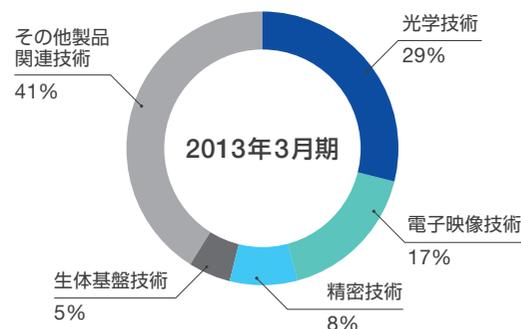
基盤技術の国内公開特許件数の推移



基盤技術の国外公開特許件数の推移



保有特許全体に占める基盤技術の割合



国別の保有特許件数

最近5年間における国別の保有特許件数の推移は次のとおりです。前期に引き続き、国外における特許取得件数を増大させていく方針のもと、権利化活動を進めてきました。

2013年3月期における保有特許件数は、国内で前期に比べ9%の増加、国外は13%の増加となりました。国外特許が全保有件数に占める割合は50%と、前期比1ポイント高まりました。

国別の保有特許件数の推移

